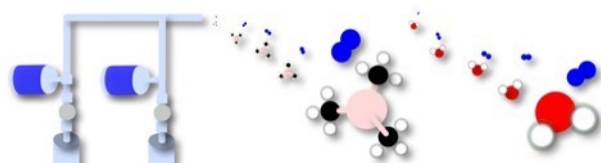


# Atomic Layer Deposition

## 原子層堆積装置



Model: AT-200M (2インチ)

### Anric Technologies社製

項目	仕様
寸法	幅: 364 x 奥行: 381 x 高さ: 368mm
基板(試料)最大サイズ	○ 2インチ (50mm) (立体構造物も可能) 粉体オプションあり
反応室の加熱温度	Max. 300°C
加熱方式	ホットウォール式
搭載プリカーサー	有機金属: 1本、H <sub>2</sub> O (又はO <sub>2</sub> /O <sub>3</sub> ): 1本 (計2系統)
プリカーサー加熱温度	Max 145°C
プリカーサー投入方式	時間制御

輸入総代理店:

ALDジャパン株式会社

〒183-0056 東京都府中市寿町1-3-10-401

Phone: 042-360-3152 Fax: 042-633-0916

E-mail: [sales@aldjapan.com](mailto:sales@aldjapan.com)

